



Q. Metrology, Inspection, Analysis, and Yield Enhancement 분과

2021년 1월 29일(금), 13:00-14:30 / 채널 A

[FA3-Q] Metrology, Inspection, and Yield Enhancement II

좌장: 박병천 박사 (KRISS), 양준모 박사 (나노종합기술원)

<p>FA3-Q-1 13:00-13:30</p>	<p>[초청] In Situ TEM Probing and Electron Tomography for Semiconductor Material and Device Characterization Gyeong-Su Park <i>Department of Materials Science and Engineering, Seoul National University</i></p>
<p>FA3-Q-2 13:30-14:00</p>	<p>[초청] EUV Mask Defect Inspection and Repair using In-line AFM Byoung-Woon Ahn, Ah-Jin Jo, and Sang-Joon Cho <i>Park Systems Co., Ltd.</i></p>
<p>FA3-Q-3 14:00-14:15</p>	<p>VRS Test로부터 TDDB 메커니즘에 기반한 Gate Oxide 품질 특성 추출 방법 Hakgyun Kim¹, Bumsuk Chung¹, Yuchul Hwang¹, Namhyun Lee¹, Hyungcheol Shin² ¹<i>Samsung Electronics Co., Ltd.</i>, ²<i>Device Research Laboratory, Seoul National University</i></p>
<p>FA3-Q-4 14:15-14:30</p>	<p>대용량 및 중용량 터보분자펌프 핵심 성능 평가 플랫폼 개발 심섭¹, 문지훈¹, 박재서^{1,2}, 송선민^{1,3}, 임종연¹, 제갈원¹, 강상우^{1,2} ¹한국표준과학연구원 첨단측정장비연구소, ²과학기술연합대학원대학교 측정과학전공, ³대전대학교 신소재공학과</p>